國 立 交 通 大 學

電 子 工 程 學 系 電 子 研 究 所

碩 士 論 文

以新穎降電場結構改善低溫多晶矽薄膜電晶體特性之研究

Study on the Novel Drain-Relief Structures in Low-Temperature Polycrystalline Silicon Thin Film Transistors to Improve the Device Characteristics

研 究 生：廖 大 傳

指導教授：鄭 晃 忠 教授

中華民國 九十四 年 七 月

以新穎降電場結構改善低溫多晶矽薄膜電晶體特性之研究

Study on the Novel Drain-Relief Structures in Low-Temperature Polycrystalline Silicon Thin Film Transistors to Improve the Device Characteristics

研 究 生 ： 廖大傳　　Student : Ta-Chuan Liao

指導教授 ： 鄭晃忠 博士　　Advisor : Dr. Huang-Chung Cheng

國立交通大學

電子工程學系　電子研究所

碩士論文

A Thesis

Submitted to Department of Electronics Engineering

and Institute of Electronics

College of Electrical Engineering and Computer Science

National Chiao-Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master in

Electronics Engineering

July 2005

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國 九十四 年 七 月